2023/11/20

東アジアの早期公開・登録特許推移

アジア特許情報研究会：伊藤徹男

１．はじめに

各国とも、特許出願後、１年６か月が経過したときは出願公開をしなければならない、と定められていますが、出願後１年６か月前であっても出願人の請求により、出願の早期公開が可能となっています。出願から公開までに第３者に模倣されることを防ぐために、とも言われていますが、その目的は定かではありません。

日本の場合、早期公開が出願と同時であれば約5か月程度、出願の方式審査が完了し、出願公開請求手続完了後早ければ2週間程度で公開特許公報が発行される、とされています。[1)]

日本では2022年5月に成立した経済安全保障推進法により「特許出願の非公開に関する制度」も設けられることとなり、満足にデータベースから情報を得ることができにくくなるかもしれません。[2)]

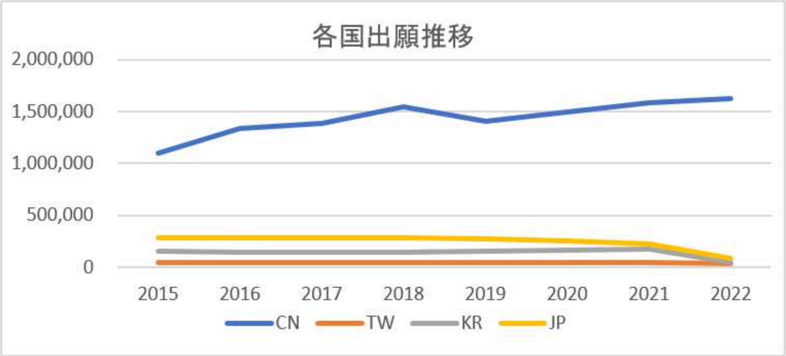
これまでに中国の早期公開状況については機会あるごとにセミナーや雑誌論文などでも紹介してきましたが、[3), 4), 5)] 本稿では、台湾、韓国、日本の早期公開・登録状況にも目を向けて東アジア４国の状況を概観してみたいと思います。

２．中国、台湾、韓国、日本の早期公開・登録状況（特許）

まず最初に2015年以降、2022年までの各国の出願推移を見てみます（図１）。中国の出願数が台湾、韓国、日本などと比べて１桁近くも違うので同一のグラフでは見づらいですが、中国の場合には2019年の出願数減少を除き、2022年出願分も2021年出願に比べ増加しています。これは中国の場合には他の３国と比べ、出願から６か月以内に公開となる割合が７割以上ともなっていることが要因となっています。

（2019年の出願数減少については、中国の非正常出願取締りの影響ではないかと考察しています。[6),7)]

図１．東アジア４国の出願推移



これに対し、台湾等３国の 2022 年出願数は 2021 年より少なくなっています。2023 年 11 月時点では早期公開されている案件が中国ほど顕著ではないことを示しています。このように出願年基準で収録を確認する場合には出願から１年６か月未満の未公開分が現れず、あたかも出願数が減少しているかのように見えるので注意が必要です。

１） 早期公開特許、登録特許

2015 年～2022 年の出願から 6 か月以内、1 年以内、1 年 6 か月以内、2 年以内に公開された特許および登録された特許について示したのが図２～図５です。

図２．中国の早期公開特許および登録特許

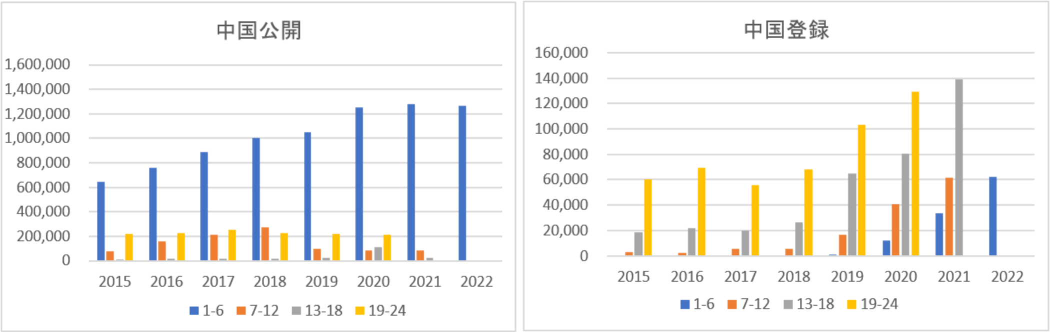


図３．台湾の早期公開特許および登録特許

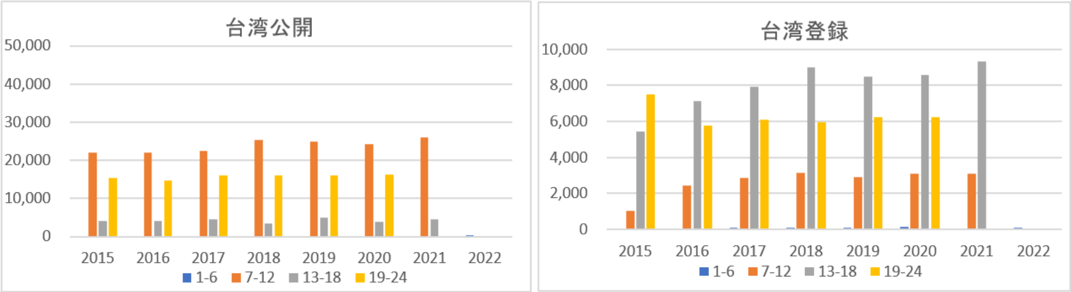
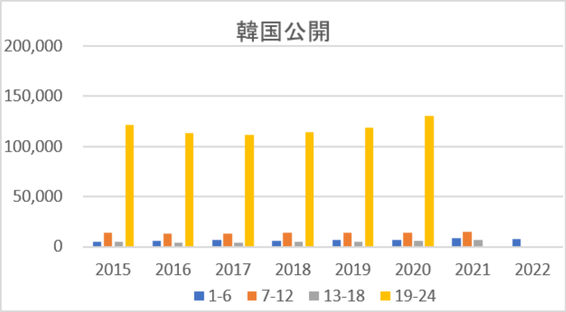


図４． 韓国の早期公開特許および登録特許



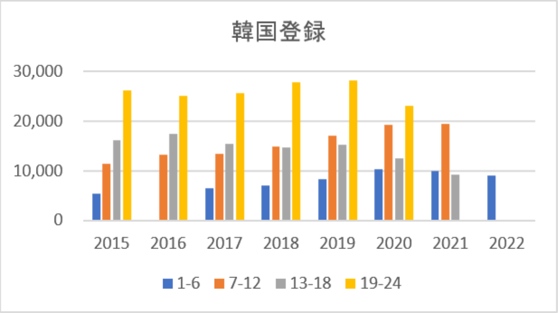
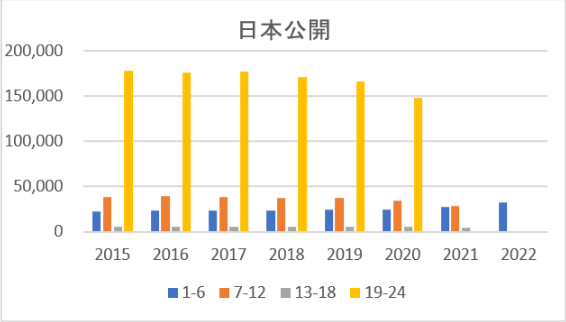
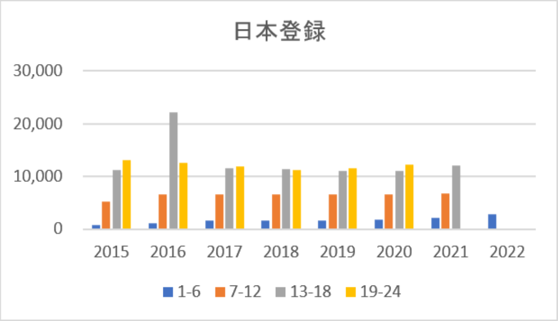


図５． 日本の早期公開特許および登録特許





2021 年の 19～24 か月および 2022 年の 7 か月以降のデータは、2023 年 11 月時点ではまだ公開（登録）データが満足に取得できないため欠落した状態となっています。

中国においては圧倒的に出願から 6 か月以内に公開になるものが多いことがわかります。登録特許も出願から 6 か月以内に登録となるものが少しずつ増えてきました。

これに対して、韓国や日本では出願から 6 か月以内に公開になるものはわずかです。そして、出願から 19～24 か月公開のものがほとんどとなっているのは、「特許出願後、１年６か月が経過したときに出願公開」というルールが順守されているために１年６か月が経過した 19 か月目にほとんどが公開されるためです。

また、韓国では出願自体が日本より少ないにも拘わらず、出願から１年以内の登録が日本より多くなっていることから、韓国特許庁が早期審査に力を入れていることが窺えます。

２）超早期公開特許および登録特許

そこで、さらに掘り下げ、出願～1 年以内の公開と登録の状況を見てみたいと思います。ここでは 2019 年出願～2022 年出願について出願から１か月ごとの公開、登録状況を４か国について図６～図９に示しました。

図６．　中国の超早期公開特許および登録特許

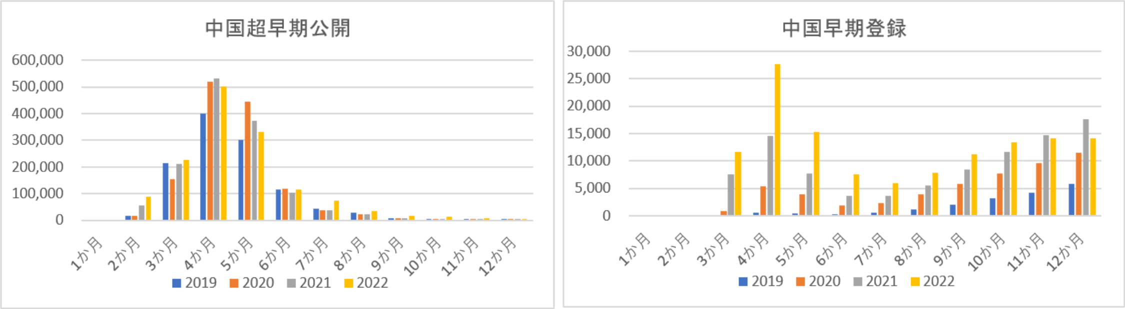


図７．　台湾の超早期公開特許および登録特許

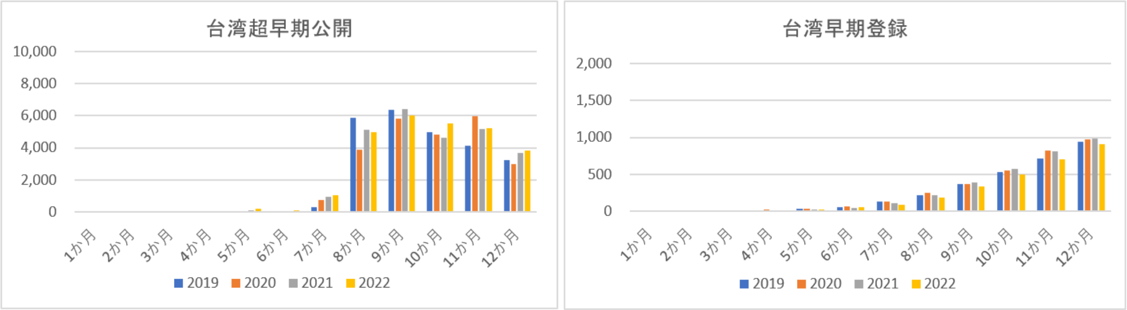


図８．　韓国の超早期公開特許および登録特許

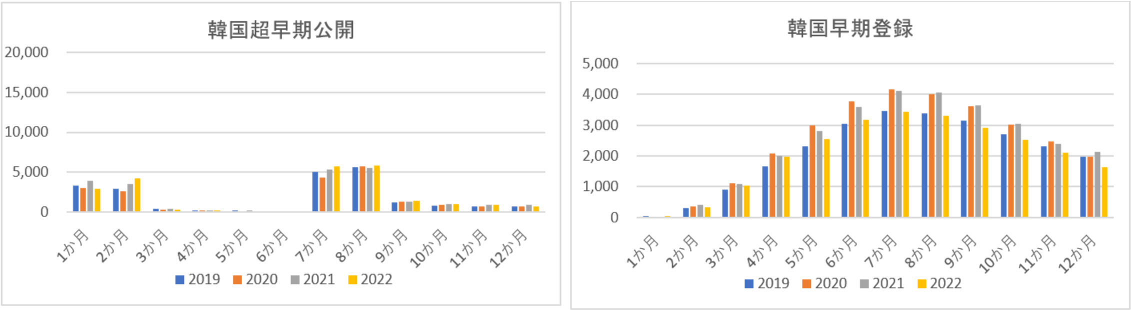
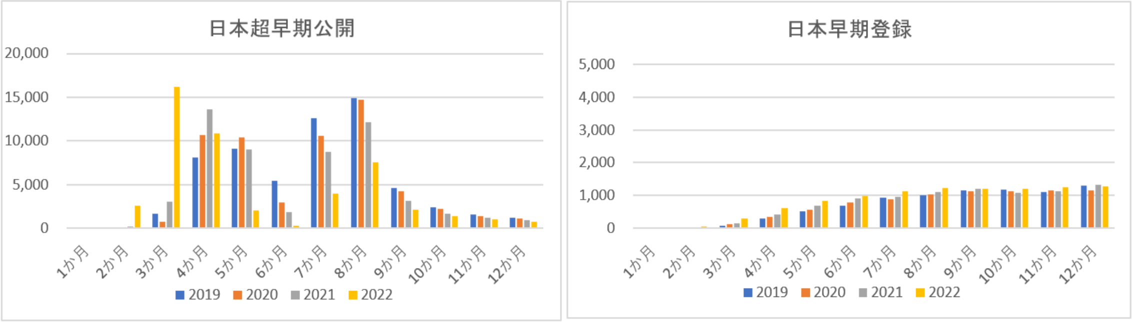


図９．　日本の超早期公開特許および登録特許



中国の出願から6か月以内の早期公開もその多くは出願から4か月〜5か月に集中していることが図6からわかります。登録の状況も2019年に比べ、2022年ではより早くなっていることが確認できます。

台湾の出願から6か月以内公開はほとんどなく、出願から7か月〜12か月に集中しています。

また、韓国は不思議なことに出願から3か月〜6か月の公開がありません。韓国の場合には「公開になる前に登録となった場合には公開公報は発行されない」というルールがあるためにこの部分の公開公報が欠落しているのでしょうか。さらに充分な考察が必要ですが。

通常は早期審査請求をしない限り、公開公報が出る前に登録になることはないので「特許の watching はまずは公開公報情報で」という常識は韓国の場合には通用せず、公開特許＋登録特許を同時に watching する必要があります。[8)]

表1．韓国2020年出願案件

Application No.	Status	Application Date	Registration No.	Registration Date	Unex. Pub. No.	Unex. Pub. Date	
1020200003806	Registered	2020.01.10	1026041680000	2023.11.15	1020210090469	2021.07.20	通常公開登録
1020217031086	Unexamined	2020.01.14			1020210129196	2021.10.27	
1020217027836	Registered	2020.01.31	1026043210000	2023.11.16	1020210118937	2021.10.01	通常公開登録
1020200014626	Registered	2020.02.07	1021434870000	2020.08.05			公開前登録
1020200018666	Registered	2020.02.15	1021869250000	2020.11.30			公開前登録
1020200021756	Registered	2020.02.21	1021523270000	2020.08.31			公開前登録
1020200024036	Unexamined	2020.02.27			1020210109154	2021.09.06	
1020200028786	Registered	2020.03.09	1021825370000	2020.11.18			公開前登録
1020217042216	Unexamined	2020.03.18			1020220050091	2022.04.22	
1020200033166	Registered	2020.03.18	1024250160000	2022.07.20	1020210116948	2021.09.28	通常公開登録
1020217034286	Registered	2020.03.24	1026042180000	2023.11.15	1020210143267	2021.11.26	通常公開登録
1020200036356	Unexamined	2020.03.25			1020210119775	2021.10.06	
1020217027246	Unexamined	2020.03.27			1020210116650	2021.09.27	
1020200038646	Registered	2020.03.30	1021888600000	2020.12.03			公開前登録

韓国特許情報院データベース KIPRIS における2020年出願案件（一部）を表1に示しました。黄色でマークした部分が公開公報が発行されない公開前登録情報です。

出願から12か月以内の韓国の早期登録情報（図８）でも日本の登録情報より多く、審査が早いことが確認できます。

日本でも出願から12か月以内の公開が存在することは図5でも確認できましたが、より詳細な情報を図9でも確認できました。

３．まとめ

これまで早期公開特許情報は中国を中心に見てきましたが、中国ほど顕著でなくても

台湾、韓国、日本の概要についても把握できました。

参考文献：
1) 公報に関するよくあるご質問
https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/general/koho_faq.html#anchor1-3
2) 特許出願非公開制度の施行に向けて
https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2023/0615_06.html#:~:text=2022%E5%B9%B45%E6%9C%88%E3%81%AB,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82
3)中国早期公開特許の最新動向(特技懇 No.292 2019)
http://patentsearch.punyu.jp/asia/tokugikonNo.292.pdf
4)中国早期公開特許(検索 Tips 2020/7/27)
http://patentsearch.punyu.jp/asia/CN_early2020.pdf
5)中国特許情報の最新動向：非正常出願の実態(Japio YEARBOOK2022)
https://japio.or.jp/00yearbook/files/2022book/22_2_04.pdf
6) 中国特許情報・非正常出願の実態
https://japio.or.jp/00yearbook/files/2022book/22_2_04.pdf
7)中国の非正常出願について
http://patentsearch.punyu.jp/asia/copy_patent.pdf
8) 韓国における「公開前登録」情報について
http://patentsearch.punyu.jp/asia/KR_REG.pdf

以上